

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

REC'D 06 JAN 2005

WIPO PCT

Référence du dossier du déposant ou du mandataire	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/PEAA16)	
Demande internationale No. PCT/FR 03/03788	Date du dépôt international (jour/mois/année) 18.12.2003	Date de priorité (jour/mois/année) 20.12.2002
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB G03F7/095		
Déposant COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et al.		

1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.



2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.

- ☐ Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).

Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le présent rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :

- I ☒ Base de l'opinion
- II ☐ Priorité
- III ☐ Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- IV ☐ Absence d'unité de l'invention
- V ☒ Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- VI ☐ Certains documents cités
- VII ☐ Irrégularités dans la demande internationale
- VIII ☐ Observations relatives à la demande internationale

Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 12.07.2004	Date d'achèvement du présent rapport 05.01.2005
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international  Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Fonctionnaire autorisé Thiele, N N° de téléphone +49 89 2399-2598 

PCT/FR 03/03788

**RAPPORT D'EXAMEN
PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n°

PCT/FR 03/03788

5. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport.)

6. Observations complémentaires, le cas échéant :

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration Nouveauté	Oui:	Revendications	1-11
	Non:	Revendications	
Activité inventive	Oui:	Revendications	1-11
	Non:	Revendications	
Possibilité d'application industrielle	Oui:	Revendications	1-11
	Non:	Revendications	

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Concernant le point V

Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

Il est fait référence aux documents suivants:

- D1: EP-A-0 851 295 (ECOLE POLYTECH) 1 juillet 1998 (1998-07-01)
- D2: DE 37 02 897 A (MERCK PATENT GMBH) 11 août 1988 (1988-08-11)
- D3: US-A-2 964 401 (PLAMBECK JR LOUIS) 13 décembre 1960 (1960-12-13)
- D4: "Photosensitive material for forming image, consists of a support provided with a photosensitive layer and hardenable layer which is surface treated by corona and flow discharge" DERWENT, 31 mai 1994 (1994-05-31), XP002258655
- D5: "Removal of image by resist film lead frame - by laminating new pressure-sensitive adhesive or adhesive sheet, which is curable, on image using resist film, hardening adhesive layer and releasing layer with resist" DERWENT, 26 mai 2000 (2000-05-26), XP002258656
- D6: WO 01/37050 A (NIENHAUS MATTHIAS ; SCHMITZ FELIX (DE); INST MIKROTECHNIK MAINZ GMBH () 25 mai 2001 (2001-05-25)
- D7: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 0124, no. 07 (E-675), 27 octobre 1988 (1988-10-27) & JP 63 146599 A (KYORITSU KAGAKU SANGYO KK; others: 02), 18 juin 1988 (1988-06-18)

Les documents D2 à D4, qui sont considérés comme étant l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1 décrivent

des structures avec une couche entre un substrat et une couche photostructurable; selon D2 cette couche n'est pas nécessairement négative et le photo-amorçeur est fixé à une composant polymère; dans D3 cette couche est la même couche comme la couche photostructurable comportant une concentration plus élevée du photo-amorçeur, et selon D4 cette couche est une couche durcissable, qui est traitée par effet couronne.

Le document D1, qui est considéré comme moins pertinent, divulgue (entre un substrat et une couche photostructurable) une couche sacrificielle, qui préféablement consiste d'aluminium. Les documents D5 à D7 sont aussi considérés comme moins pertinents; D7 concerne un papier renforcé et D5 et D6 ne divulguent pas des couches adhésives avec un polymère (élastomère) et un photo-amorçeur.

L'objet de la revendication 1 est donc nouveau (article 33(2) PCT).

Le problème que la présente invention se propose de résoudre peut donc être considéré comme fournir une couche adhésive particulièrement utilisable pour la formation des microstructures; ce problème n'est pas adressé directement dans les documents cités.

Pour cette raison la solution de ce problème proposée dans la revendication 1 de la présente demande est considérée comme impliquant une activité inventive (article 33(3) PCT).

Les revendications 2 à 11 dépendent de la revendication 1 et satisfont donc également, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive.